

تأثير التلدين الحراري السريع على غشاء CuO المحضر بطريقة الترسيب

النبضي بليزر النديميوم ياك.

د.مسلم فاضل جواد* و هبة سلام طارق*

تاريخ التقديم: 2009/7/9

تاريخ القبول: 2010/2/16

الخلاصة

في هذا البحث تم ترسيب غشاء رقيق من مادة CuO على قواعد من الزجاج باستخدام تقنية التبخير الحراري بواسطة ليزر Nd-YAG النبضي . أوضحت النتائج قياسات الأشعة السينية ان الأغشية المحضرة متعددة التبلور polycrystalline . ثم أجريت القياسات البصرية على الأغشية لتحديد طيف النفاذية والامتصاصية كدالة للطول الموجي الساقط ومن تحديد المعاملات البصرية وجد معامل الامتصاص ومعامل التخميد وثابت العزل الكهربائي بجزأيه الحقيقي والخيالي وقيمة معامل الانكسار وقيمة ونوع فجوة الطاقة فقد وجد ان فجوة الطاقة لمادة CuO (1.8 eV) والأغشية ذات انتقال مباشر وهذه النتائج مقارنة لنتائج التي تم الحصول عليها مسبقا . وجرى تلدين الأغشية الرقيقة حراريا "سريعا" باستعمال مصباح هالوجيني حيث وجد ان التلدين الحراري السريع يؤثر كثيرا" على الأغشية المحضرة حيث أدى التلدين الى تحسين خصائص الأغشية .

Effect of Rapid Thermal Annealing on CuO Thin Film Prepared by PLD

Abstract

In this study, thin films of CuO were deposited on glass substrates using thermal laser evaporation technique. The structure characterization of the film was carried out with XRD. The results of XRD show that all samples have a polycrystalline. The optical measurements on the deposited films were performed to determine the transmission spectrum and the absorption coefficient as a function of incident wave length. Then from the optical parameters, extinction coefficient, dielectric constant with two part real and imaginary part, value and type of energy gap, type of the dominant absorption processes, real and complex refractive index as functions of incident photon energy, were determined. The energy gap is found to be equal to 18 eV for CuO that is direct transfer. This results is agree to the results given by other researchers. Then thin films annealed thermal rapid by using halogen lamp. The annealing influence very much to thin film by addition an enhancement to the thin films

المقدمة

المادة يجب أن يكون هناك امتصاص لشعاع الليزر. اذ ان هذا الامتصاص يكون مهما" جدا لحدوث عملية تفاعل الليزر مع المادة . عملية الامتصاص هذه تعد مصدرا" اساسيا" للطاقة داخل المادة . وهذا المصدر الاساسي يوضح بأن الشعاع

منذ تصنيع أول منظومة ليزر في بداية الستينات ومجالات استخدام الليزر في تزايد بحيث لم يعد هناك مجالا لم يدخله الليزر ولقد تمكن الباحثون من تبخير مواد يصعب تبخيرها بالطرق الأخرى مثل [1] (Mo) . لكي يحدث الليزر تأثير في

القياسات التركيبية التي تضمنت 1- الاشعة السينية وذلك للتعرف على البنى الطورية للأغشية استخدم جهاز حيود الاشعة السينية نوع

(Phillips PW 1050) الذي يعمل مع الاشعة السينية بطول موجي 1.93728Å من مصدر Fe-Kα

2- التركيب الدقيق والطبوغرافية السطح وذلك لغرض فحص سطوح الاغشية الرقيقة والتأكد من صلاحيتها للدراسة استخدام المجهر الضوئي العاكس نوع leit3-Metallax بقدرتك تكبير 600 مرة وشملت القياسات البصرية وذلك بحساب الثوابت البصرية وقيمة فجوة الطاقة لغشاء (CuO) وذلك عن طريق دراسة طيفي النفاذية والامتصاصية للأغشية المحضرة باستخدام مطياف من نوع UV-VIS- NIR-Double beam spectrophotometer. ثم بعد ذلك جرى تلدين الاغشية الرقيقة حرارياً "سريعاً" باستعمال مصباح هالوجيني ذو قدرة 1000 (W) بدرجات حرارية مختلفة (300, 400, 500 °C). ويزن من تلدين (3) دقائق.

النتائج والمناقشة :

القياسات التركيبية

توضح الاشكال (2-a) - (2-b) - (2-c) - (2-d) نتائج حيود الاشعة السينية لغشاء (CuO) غير المملد والمملد حرارياً بدرجات مختلفة حيث نجد ان الاغشية المحضرة متعددة اذ امتلك المستويات

البلورية (111)، (111) وهذا يتطابق مع البحوث المنشورة [11] وذلك بعد مقارنتها مع الجداول القياسية لـ ASTM. وعند التلدين بدرجة حرارة 300°C نلاحظ حدوث زيادة شدة انعكاس المستويات البلورية (111) (111) وظهور مستوى بلوري جديد هو (020) نتيجة تأثير التلدين الحراري السريع بهذه الدرجة وهذا يعني

الليزري المنبعث من المصدر يحدد ماذا يحصل للمواد المشعة بالليزر واوكسيد النحاس يعتبر واحد من اهم المواد التي تدخل في التطبيقات الالكترونية ضوئية [2-5] ويعتبر من المواد القليلة الكلفة وغير سامة [6]. يمتاز اوكسيد النحاس باللون البني الغامق مائل الى السواد عديم الرائحة، له الكثير من التطبيقات الطاقة الشمسية ولا سيما المجمعات الضوئية-الحرارية الشمسية اذ تتطلب هذه التطبيقات كفاءة عالية ومدى جيد من الاستقرار وكذا ذلك تتطلب امتصاصية عالية في مدى الطول الموجي المرئي، وغشاء اوكسيد النحاس يمتلك توصيلية موجبة وقيمة فجوة الطاقة (1.8 eV) لغشاء (CuO) [7-8]. ولغشاء اوكسيد النحاس تطبيقات كثيرة في الكواشف والخلايا الشمسية الهجينة [4] [2]. وغشاء اوكسيد النحاس (CuO) يمتلك معامل امتصاص بصرية تجعل منه ملائم في تصنيع الخلايا الشمسية ذات الأغشية الرقيقة [9].

الجانب العملي:

جرى في هذا البحث ترسيب غشاء رقيق من اوكسيد النحاس (CuO) بسمك (200nm) على قاعدة من الزجاج ذات ابعاد (7cm * 2.5cm) وذلك باستخدام تقنية التبخير بواسطة ليزر Nd-YAG النبضي بطول موجي (1.06 μm) ذو طاقة (700 mJ) وامتد نبضة (10 ns) صنع من قبل شركة Diamond.288 (pattern EPLS)، وشملت منظومة التبخير على حجرة تبخير تتضمن نافوس زجاجي (Bell jar) مصنع من زجاج البايروكس بسمك 1mm وقطر 320mm وارتفاع 45cm ومنظومة تبريد تكونت من مضخة ميكانيكية دوارة نوع Edward حيث اوطأ تم الحصول عليه من هذه المضخة هو 10⁻³ torr كما موضح في الشكل (1) وتضمن الجانب العملي

الطول الموجي أي من (400-900nm) وهذا يتفق مع [10] ويوضح الشكل نفاذية غشاء (CuO) المملدن بدرجات حرارة مختلفة (300,400,500 °C) إذ نجد أنه بزيادة درجة حرارة التلدين سوف تمتلك الأغشية نفاذية أعلى فكانت أعلى نفاذية تم الحصول عليها هي عند التلدين الحراري السريع بدرجة (500 °C) أي ان التلدين الحراري السريع عمل على زيادة النفاذية البصرية، ويبين الشكل (5) علاقة معامل الامتصاص (α) لغشاء (CuO) مع طاقة الفوتون الساقط (λ) ويلاحظ ان قيمة معامل الامتصاص تزداد بشكل ضئيل في منطقة الطاقات الواطئة (الاطوال الموجية الطويلة) فيما تصبح الزيادة سريعة في منطقة الطاقات الاعلى (الاطوال الموجية الاقصر) والتلدين الحراري السريع يؤثر تأثيراً واضحاً في معامل الامتصاص للأغشية المحضرة إذ نجد من الشكل انه بزيادة درجة حرارة التلدين تنقص قيمة معامل الامتصاص. فبلغت قيمة معامل الامتصاص لغشاء CuO عند درجة حرارة (500 °C) لطاقة فوتون (2.8eV). ($4.8 \times 10^4 \text{ cm}^{-1}$). جرى رسم علاقة ما بين مربع قيمة معامل الامتصاص ($ah\nu$) وطاقة الفوتون الساقط ($h\nu$) كما الشكل (6) وذلك لتحديد قيمة ونوع فجوة الطاقة حيث وجد ان قيمة فجوة الطاقة للغشاء CuO (1.8 eV) وهذه القيم مقاربة للقيم المستحصلة في بحوث ونتائج سابقة [8] تم الحصول على علاقة خطية لمادة (CuO) وهذا يؤكد ان الاغشية ذات فجوة طاقة مباشرة وان عملية الامتصاص الاساسية المباشرة المسموحة هي السائدة وان قيمة معامل الامتصاص تعطى :

$$\alpha h\nu = A[h\nu - E_g]^{1/2}$$

وكانت قيمة α حوالي ($7.5 \times 10^4 \text{ cm}^{-1}$) عند الطول الموجي القاطع لمادة (CuO). وبعد اجراء عملية التلدين الحراري السريع على اغشية اكاسيد النحاس المحضرة

ان غشاء (CuO) بدأ يتأثر عند هذه الدرجة الحرارية وهذا يتفق مع البحوث السابقة [9,10].

واما في حالة التلدين الحراري السريع لغشاء (CuO) في درجة 400 °C ، 500 °C نلاحظ ظهور زيادة ملحوظة في قيمة الشدة المنعكسة للمستويات البلورية (111)، (111)، (020) .

يملك غشاء اوكسيد النحاس (CuO) غير المملدن معدل حجم حبيبي (22 nm) اما بعد تلدين الغشاء بدرجة حرارة 500 °C فقد امتلك حجماً حبيبياً بمقدار (29 nm) وهذه الزيادة في الحجم الحبيبي يمكن ان تعزى الى تأثير التلدين الحراري السريع في الغشاء [50] .

والاشكال (3-a) - (3-b) - (3-c) - (3-d) توضح صورة بالمجهر الضوئي لغشاء (CuO) غير المملدن والمملدن بدرجات حرارية مختلفة (300-500 °C) حيث امتلك غشاء (CuO) تركيماً دقيقاً مميّزاً وبنية متراصة خالية من التشوهات . ونجد ان التلدين الحراري السريع يؤثر تأثيراً ايجابياً واضحاً في غشاء الاوكسيد المحضر، إذ نجد من خلال الشكل انه بزيادة درجة حرارة التلدين تزداد تجانسية غشاء CuO المحضر بطريقة الترسيب بالليزر ويكون توزيع الحبيبات منتظماً وسوف يقل حجم الكتل الصغيرة لذرات المادة المتطايرة المرسبة على الغشاء وسوف تكون انتظاميتها اكثر بزيادة درجة حرارة التلدين. يبدو من الشكل انه في حالة التلدين بدرجة حرارة (500 °C) هي افضل حالة ظهرت وذلك بسبب زيادة بانتظام تجانسية الغشاء وتنظيم توزيع الحبيبات .

القياسات البصرية :

يوضح الشكل (4) طيف النفاذية للأغشية المرسبة على القواعد الزجاجية كدالة للطول الموجي الساقط ويلاحظ ان نفاذية غشاء (CuO) تزداد بشكل سريع كلما زاد

لطاقات الفوتون لأغشية أكاسيد النحاس (CuO) إذ نلاحظ أن سلوك المنحني يشبه إلى حد ما سلوك معامل الخمود. والتلدين الحراري السريع له تأثير في ثابت العزل الكهربائي بجزيئه الخيالي والحقيقي إذ زيادة درجة حرارة التلدين يؤدي إلى إعادة ترتيب الذرات مما يؤدي إلى إعادة ترتيب المستويات الموضعية (Localized state) مما يؤدي إلى زيادة في توصيلية المادة وعندها سوف يكون على حساب النقصان في ثابت العزل الحقيقي. وكان أيضاً تأثير إعادة الترتيب للمستويات الموضعية داخل فجوة الطاقة لها دور كبير في نقصان ثابت العزل الحقيقي بنسبة أقل مما هو في نقصان ثابت العزل الخيالي (Dielectric losses) ومقدار الفقد في ثابت العزل يشير إلى انتظام الحوامل الحرة بشكل مستقطب دايبولات نتيجة لاستقطابها كهربائياً [12].

الاستنتاجات:

- من النتائج التي حصلنا عليها تبين
1. الأغشية الرقيقة (CuO) المحضره بطريقة التبخير الحراري بواسطة الليزر وتحت ظروف التحضير المذكوره سابقاً ذات تركيب متعدد التبلور .
2. تمتلك هذه الأغشية وفي ظروف التحضير المستخدمة في هذا البحث إنتقالات إلكترونية مباشرة مسموحة فقط .
3. من حساب فجوة الطاقة لغشاء CuO بلغت قيمتهما 1.8 eV.
4. أدى التلدين الحراري السريع إلى زيادة النفاذية البصرية لأغشية أكاسيد النحاس (CuO)
5. أثر التلدين الحراري السريع على قيمة فجوة الطاقة للأغشية أكاسيد النحاس (CuO) فزيادة درجة حرارة التلدين تناقصت قيمة فجوة الطاقة.
6. أدى التلدين الحراري السريع إلى نقصان بقيمة الثوابت البصرية إذ أدى إلى نقصان بقيمة معامل الامتصاص والانكسار

نلاحظ حدوث نقصان بقيمة فجوة الطاقة فنجد أن زيادة درجة حرارة التلدين يؤدي إلى نقصان في قيمة فجوة الطاقة والشكل (7) يبين تغير معامل الخمود (K_0) كدالة لطاقة الفوتون لغشاء (CuO) إذ نلاحظ أن هناك زيادة تدريجية لقيم معامل الخمود عند القيم الفوتونية الأقل من حافة الامتصاص تعقبها زيادة واضحة ضمن الطاقات eV (1.5-2.1) وهذه الزيادة تدل على حدوث إنتقالات إلكترونية بين حزمتي التكافؤ والتوصيل والتي أدت إلى زيادة معامل الإمتصاص ومن ثم زيادة واضحة في معامل الخمود. ويوضح الشكل أيضاً تأثير التلدين الحراري السريع على أغشية أكاسيد النحاس (CuO) حيث نلاحظ بأزدياد درجة حرارة التلدين حدوث زيادة بقيم معامل الخمود وذلك نتيجة نقصان قيمة ثابت العزل الكهربائي بجزيئه الحقيقي والخيالي لوجود ارتباط وثيق بينهما حيث العلاقة عكسية وفقاً للعلاقتين:

$$e_1 = n_o^2 - K^2 \quad \dots\dots (1)$$

$$e_2 = 2n_o K \quad \dots\dots (2)$$

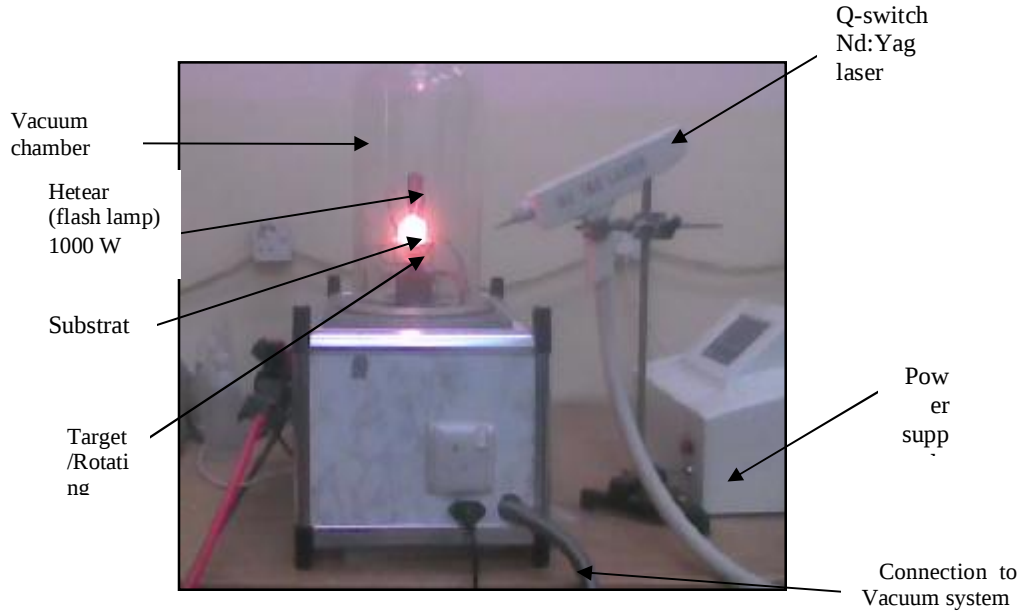
e_1 : ثابت العزل الكهربائي الحقيقي ،
 e_2 : ثابت العزل الكهربائي الخيالي .
 K:معامل الخمود.
 ومن الشكل (8) نلاحظ تغير معامل الانكسار كدالة لطاقة الفوتون لغشاء (CuO) إذ نلاحظ أن طبيعة منحني معامل الانكسار مشابهة لطبيعة منحني الانعكاسية وذلك لإرتباط الانعكاسية مع معامل الانكسار ويوضح الشكل أيضاً تأثير التلدين الحراري السريع في قيمة معامل الانكسار للأغشية المحضرة إذ نلاحظ نقصان قليل بقيمة معامل الانكسار كلما زادت درجة حرارة التلدين . ويبين الشكل (9 a , b) تغير الجزء الحقيقي و الخيالي لثابت العزل الكهربائي على التوالي كدالة

- [7] A.Sivasanker reddy, S.vthanna, p.Sreedharq reddy, Applied Surface Science vol.253,p.5287-5292, 2007.
- [8] Ming Yin, Chun Kweiwn, Yongbing Lou, Characterization of copper oxide thin films deposited by the thermal evaporation of cuprous oxide (CuO)articles published on web 2005
- [9] Yatendra S.Chandhary, International Journal of Hydrogen energy vol.29 p.131-134, 2004.
- [10] P.Stefanov, Applied Surface Science vol.253,p.1046-1050, 2006.
- [11] A.Y.Oral, Mterial Chemsyty vol.83,p.140-144, 2004 .
- [12] M.I.Ali, S.M.Jasim, Q.A.Sbbar , Iraqi journal of applied physics letters vol.1,No.2, 2008.

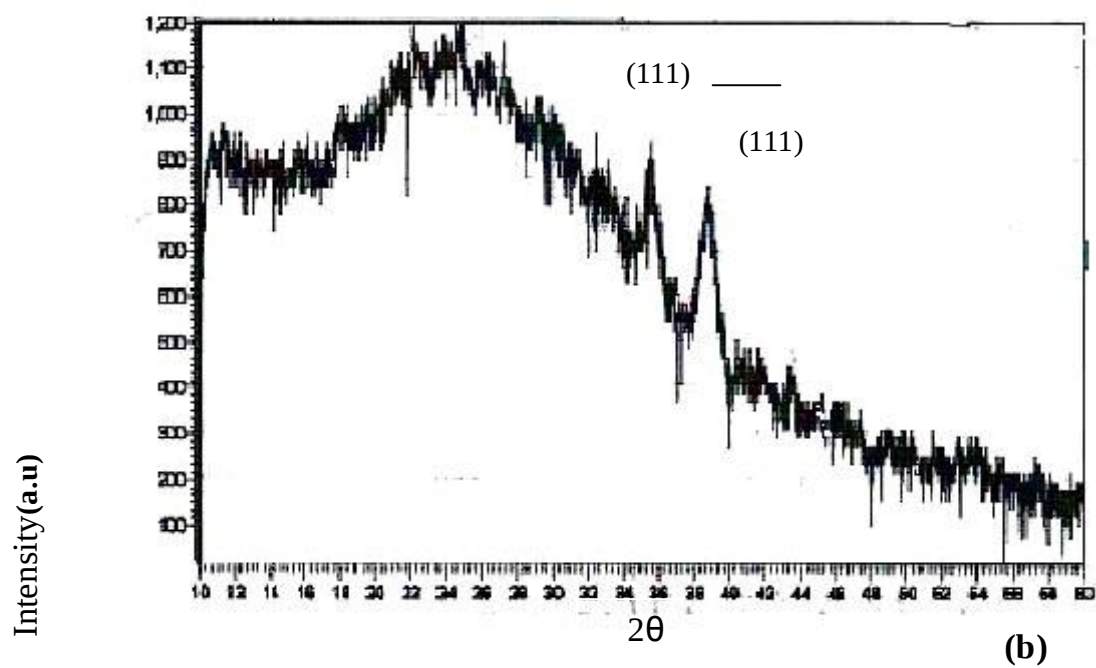
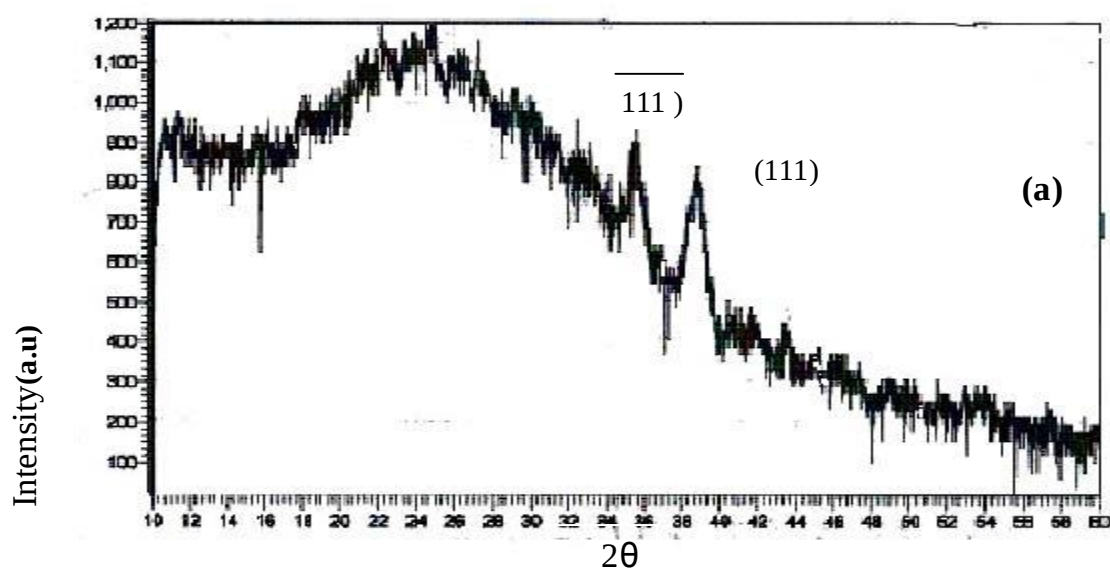
وثابت العزل بجزئيه الخيالي والحقيقي
وزيادة بمعامل الخمود(K).

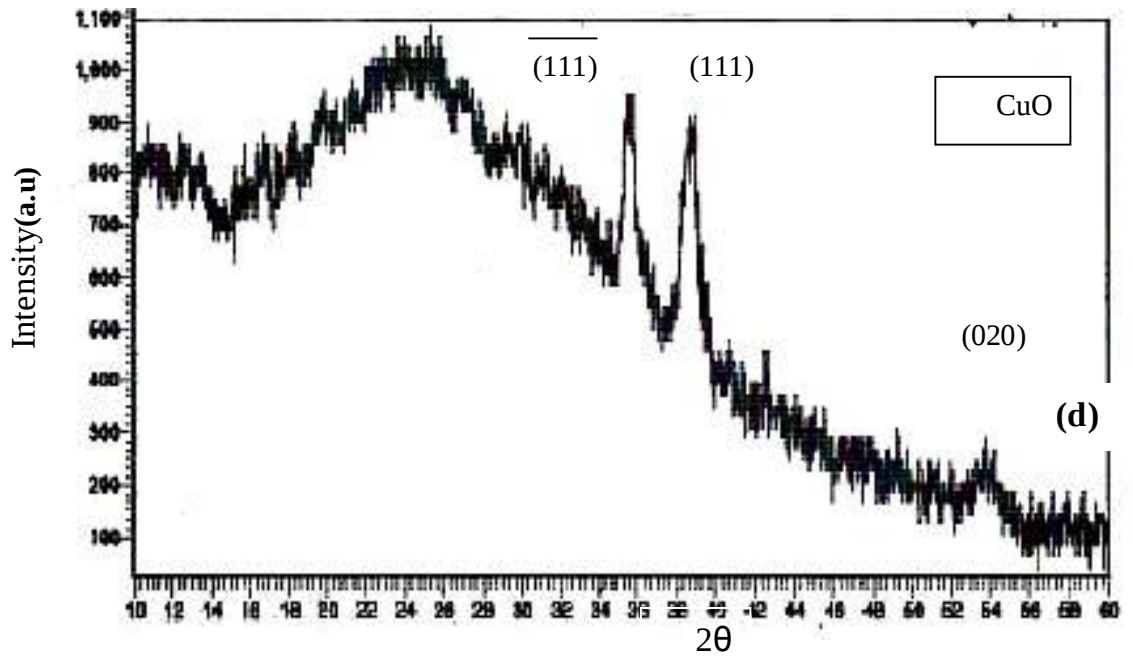
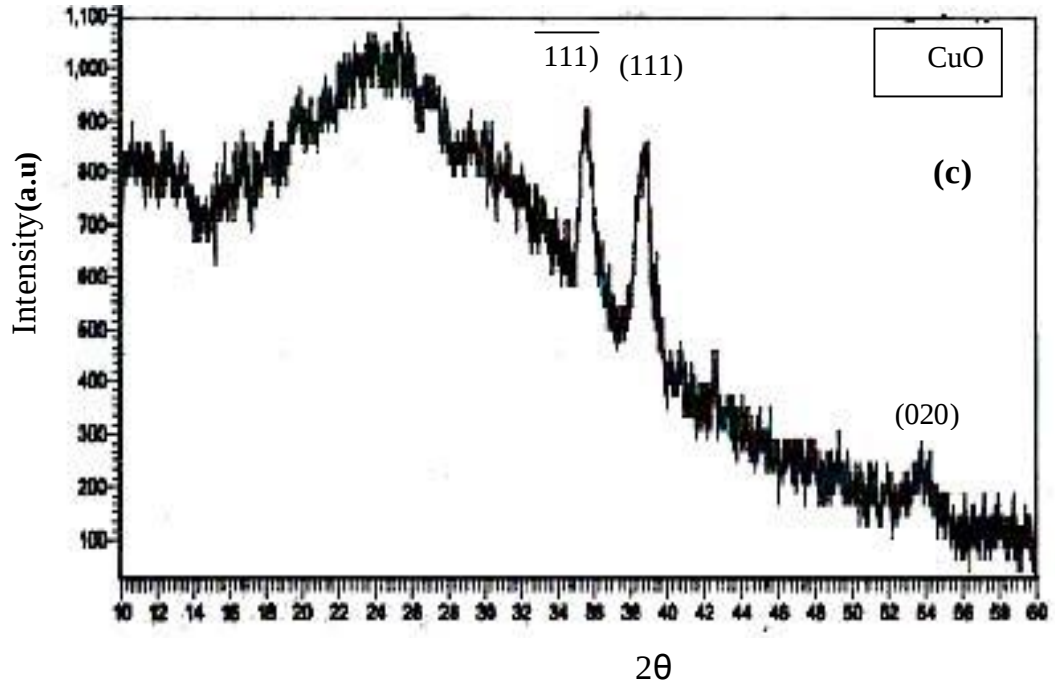
المصادر

- [1] مسلم فاضل & هبة سلام "دراسة الخصائص البصرية لاغشية اكاسيد النحاس المحضرة بالليزر " مجلة العلوم جامعة النهرين , المجلد الثاني عشر , العدد الرابع (2009)
- [2] Kuskvosky,I.L.& Tian, C.L. Phy.Rev. vol.29,p.1-8, 2001.
- [3] A.E.Rakhshan, Solid State Electronic , vol.29,No.1,p.7-17,1986.
- [4] J.R.Areland, J.G.Zhang, Solid State Electronic , vol.29,p. 84-89, 2004.
- [5] N. Serin, T.Serin, S.Horzum J.Semiconductors Science and technology , vol.20,p.398-410,2005.
- [6] A.V.Noskov, E.P.Grishina , Y.Celik, Protection of Mterials , vol.42.No.2p.149-152, 2006.

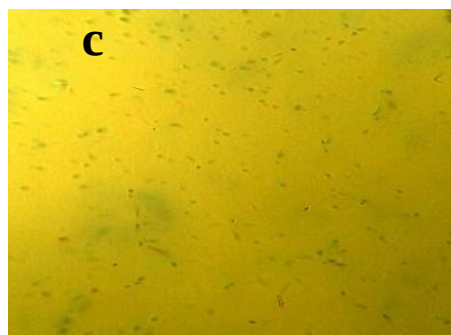
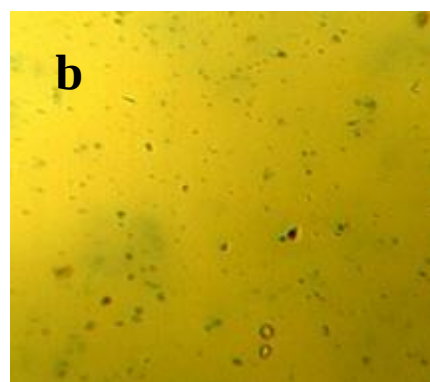


شكل (1) منظومة الليزر المستخدمة بالبحث .

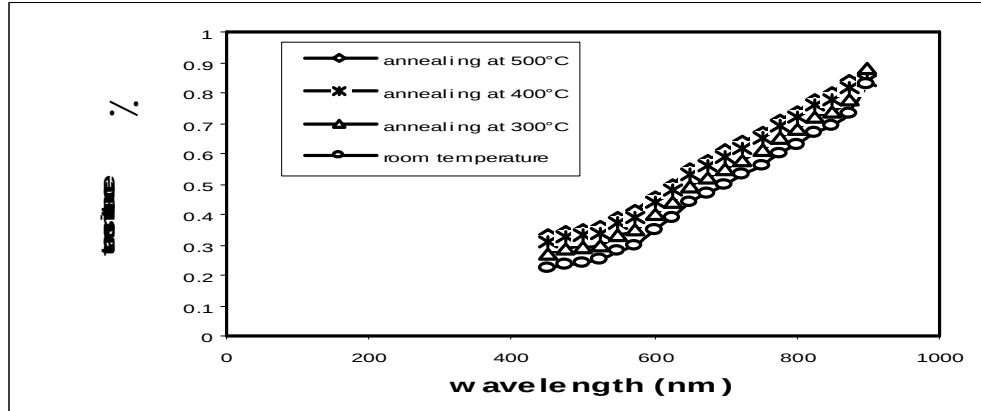




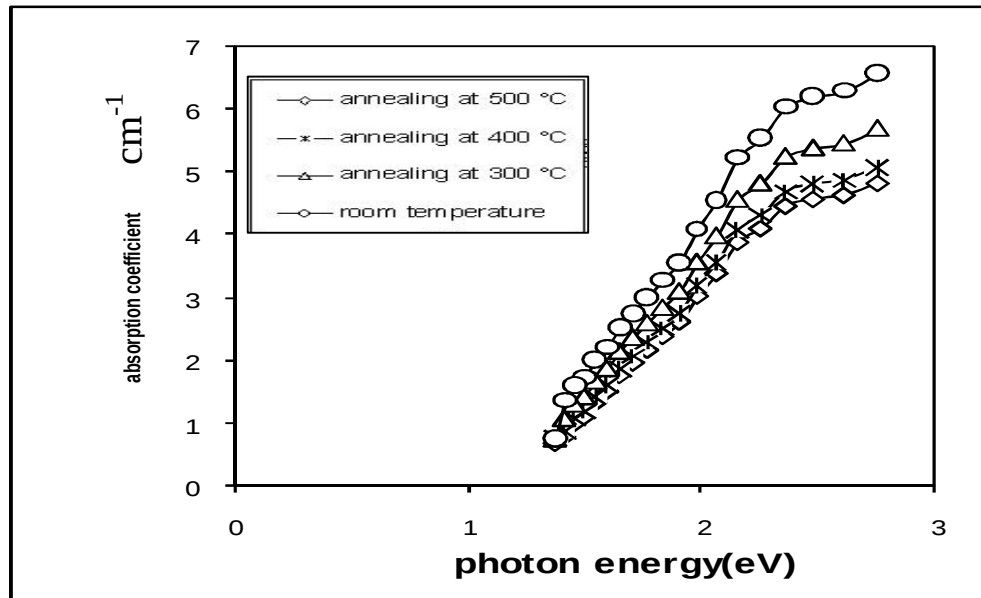
الشكل (2 a,b,c,d) نتائج حيود الاشعة السينية لغشاء (CuO) غير المملدن والمملدن حراريا بدرجات مختلفة



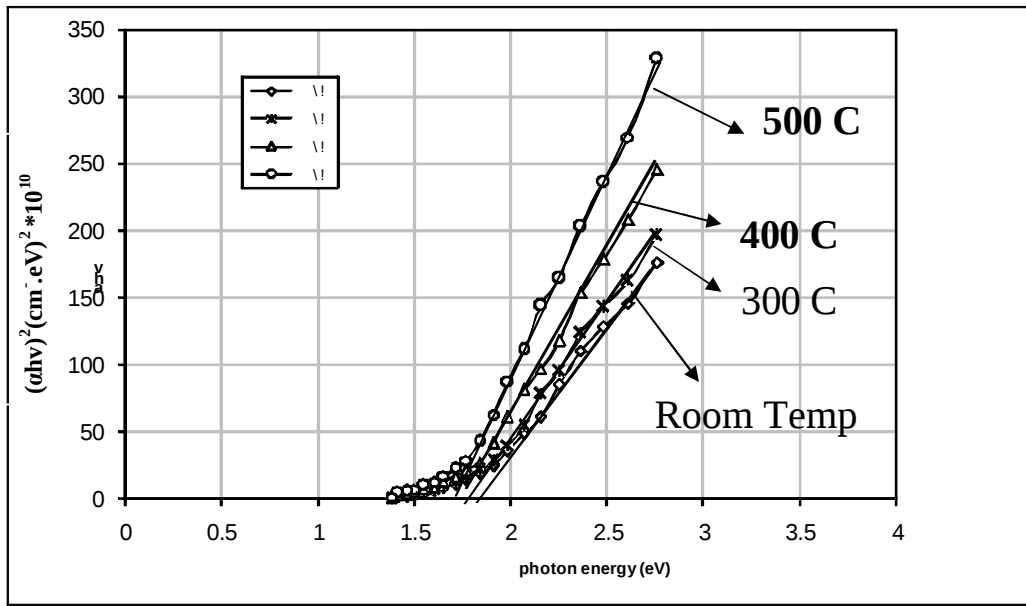
والشكل (3 a ,b,c,d) يوضح صورة بالمجهر الضوئي لغشاء (CuO) غير المملدن والمملدن بدرجات حرارية مختلفة (300-400- 500 °C)



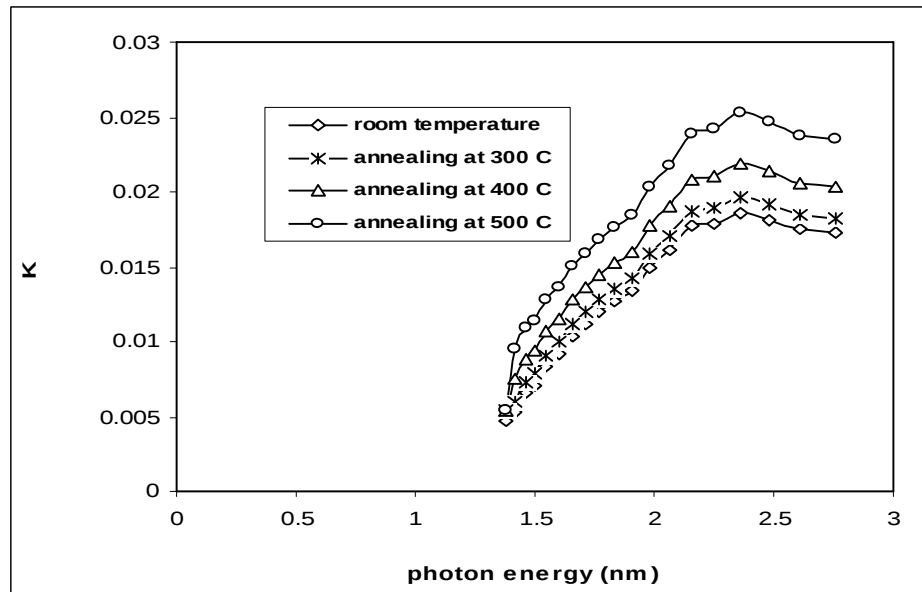
شكل (4) طيف النفاذية لغشاء اوكسيد النحاس غير الملدن والملدن بدرجات حرارية مختلفة



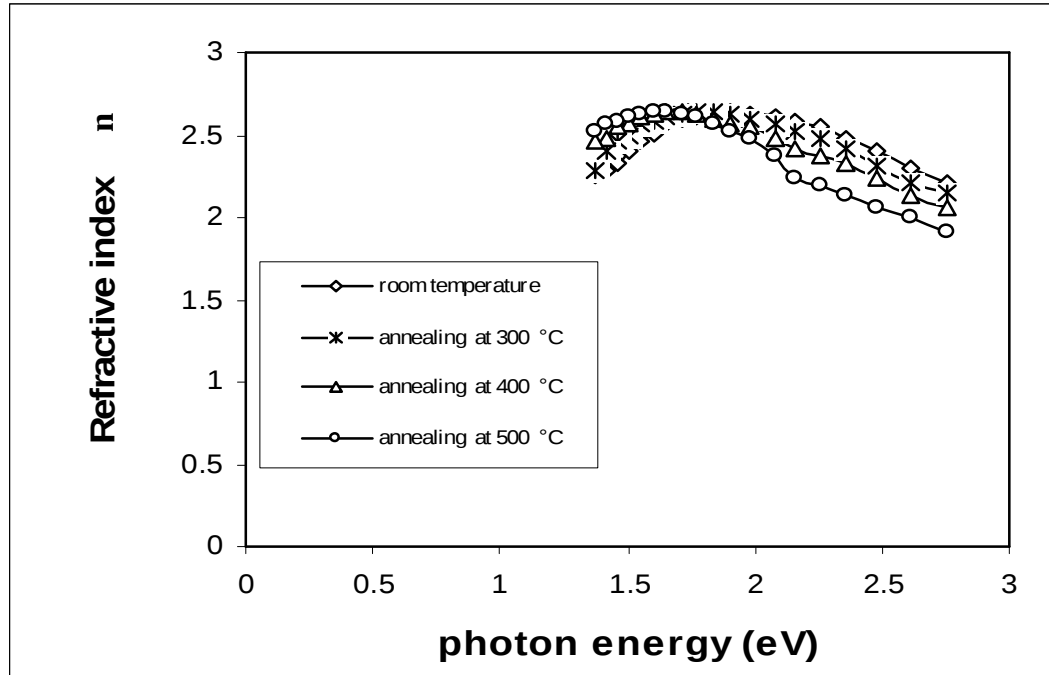
شكل (5) تغير معامل الامتصاص مقابل طاقة الفوتون الساقط لاغشية اوكسيد النحاس (CuO) غير الملدن والملدن بدرجات حرارة مختلفة.



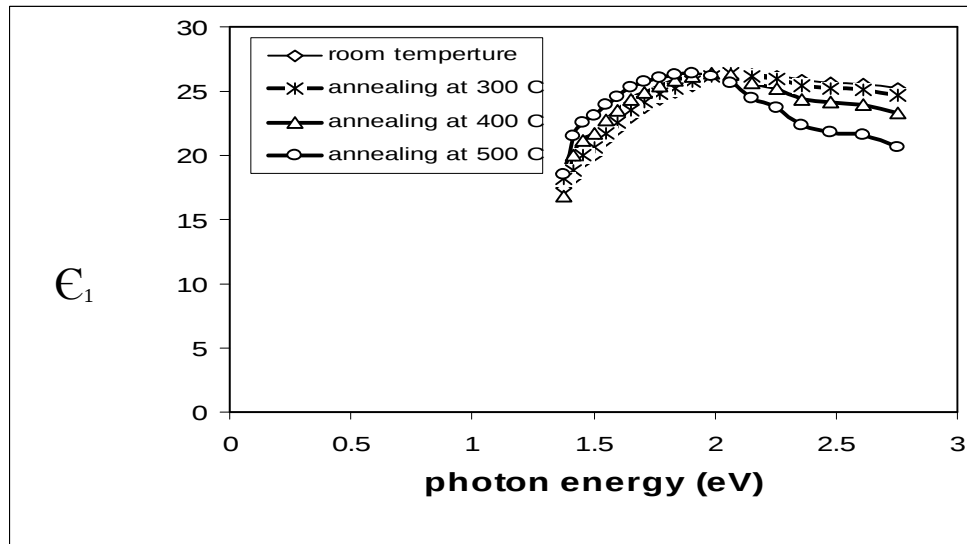
شكل (6) تغير $(\alpha h\nu)^2$ دالة لطاقة الفوتون الساقط لغشاء (CuO) غير المملدن والمملدن بدرجات حرارية مختلفة.



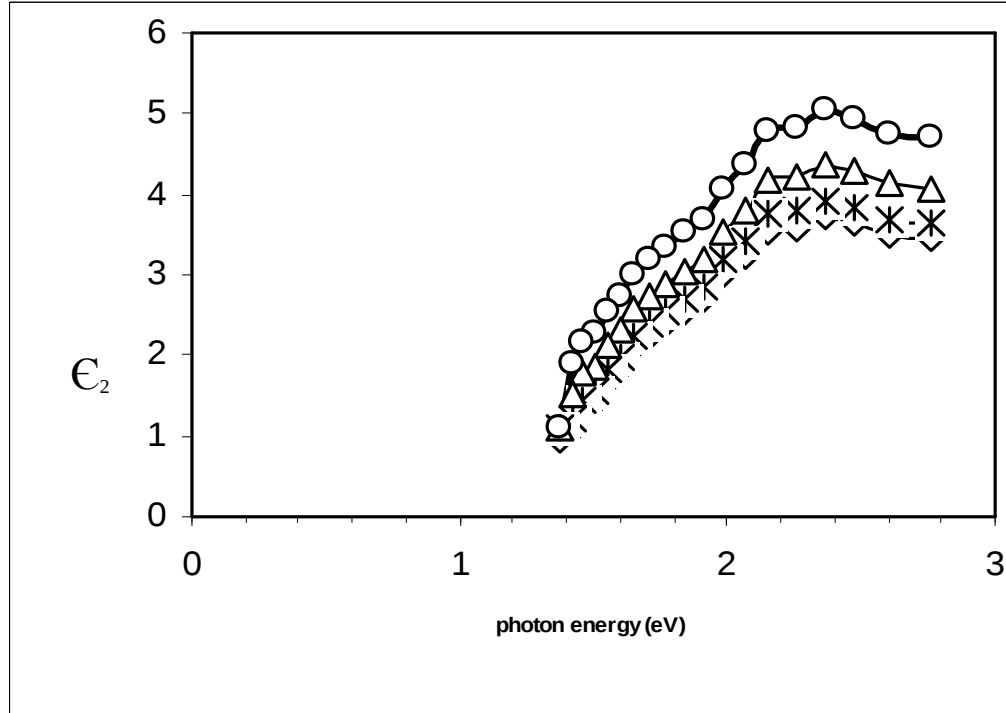
شكل (7) تغير معامل الخمود لاغشية أكسيد النحاس (CuO) غير المملدنة والمملدنة بدرجات حرارة مختلفة.



شكل (8) تغير معامل الانكسار مقابل طاقة الفوتون الساقط لأغشية اوكسيد النحاس غير المملنة والمملنة بدرجات حرارة مختلفة CuO



شكل (9.a) تغير ثابت العزل الحقيقي مع طاقة الفوتون الساقط لأغشية اكاسيد النحاس (CuO) غير المملنة والمملنة بدرجات حرارة مختلفة.



شكل (9.b) تغير ثابت العزل الحقيقي مقابل طاقة الفوتون الساقط لأغشية أكاسيد النحاس (CuO) غير
الملدنة والملدنة بدرجات حرارة مختلفة.